

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 4 月 22 日 (2021.4.22)

【公表番号】特表 2020-509925 (P2020-509925A)

【公表日】令和 2 年 4 月 2 日 (2020.4.2)

【年通号数】公開・登録公報 2020-013

【出願番号】特願 2019-544884 (P2019-544884)

【国際特許分類】

B 0 1 J 23/89 (2006.01)

B 0 1 J 35/10 (2006.01)

B 0 1 J 37/08 (2006.01)

B 0 1 J 37/02 (2006.01)

C 0 7 C 31/04 (2006.01)

C 0 7 C 31/08 (2006.01)

C 0 7 C 29/154 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 23/89 M

B 0 1 J 35/10 3 0 1 G

B 0 1 J 37/08

B 0 1 J 37/02 1 0 1 A

C 0 7 C 31/04

C 0 7 C 31/08

C 0 7 C 29/154

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 3 月 8 日 (2021.3.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

合成ガスの転化のための触媒であって、前記触媒は第 1 触媒要素及び第 2 触媒要素を有し、

前記第 1 触媒要素は、第 1 多孔質酸化物担体上に担持された、R h、M n、アルカリ金属 M、及び F e を有し、且つ、前記第 2 触媒要素は、第 2 多孔質酸化物担体上に担持された、C u、及び C u 以外の遷移金属を有する、触媒。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 8】

(i i i) の前に (i) で準備された前記触媒が還元され、前記触媒の還元は、好ましくは、水素を有するガス流と該触媒との接触を含み、該ガス流の好ましくは少なくとも 9 5 容積 %、好ましくは少なくとも 9 8 容積 %、より好ましくは少なくとも 9 9 容積 % が、水素からなり、水素を有する該ガス流は、好ましくは 2 5 0 ~ 3 5 0 までの範囲内、よ

り好ましくは 275 ~ 325 までの範囲内のガス流温度で前記触媒と接触され、且つ、水素を有する該ガス流は、好ましくは 10 ~ 100 bar (a b s) までの範囲内、好ましくは 20 ~ 80 bar (a b s) までの範囲内のガス流圧力で前記触媒と接触される、請求項 17 に記載の方法。